

用語	記号	用語の定義
化成	---	箔の表面に誘電体アルミニウム酸化皮膜 (Al_2O_3) を陽極酸化によって生成する処理
化成箔	---	表面に化成を行った箔
エッチド箔	---	化成を行う前のエッチング処理を行った箔
陽極箔	---	コンデンサの陽極に用いる箔
陰極箔	---	コンデンサの陰極に用いる箔
印加電圧	Vfe	エッチド箔を化成する時に印加する最終陽極酸化電圧
皮膜耐電圧	Vt	測定で得られる化成箔の耐電圧で、立上がり時間 (Tr) から3分後の浴電圧
公称化成電圧	Vfs	化成箔の定格耐電圧値
立上がり時間	Tr	化成箔に規定電流を流し、浴電圧が公称化成電圧 (Vfs) の90%の値 (Vr) に到達するまでの時間
立上がり時間を測定する電圧	Vr	立上がり時間 (Tr) を測定する際の到達すべき浴電圧で、公称化成電圧 (Vfs) の90%の電圧
水和処理	---	箔を高温の純水中で煮沸する処理
耐水和性試験	---	水和処理に対する箔の安定性を評価する試験
水和処理後の立上がり時間	Tr ₆₀	水和処理後の化成箔に規定電流を流し、浴電圧が公称化成電圧 (Vfs) の90%の値 (Vr) に到達するまでの時間
水和処理後の皮膜耐電圧	Vt ₆₀	水和処理後の測定で得られる化成箔の耐電圧で、立上がり時間 (Tr ₆₀) から3分後の浴電圧
初期の静電容量値	C ₀	陰極箔の初期の静電容量値で ΔC_{60} の算出に使用する
水和処理後の静電容量値	C ₆₀	陰極箔の水和処理後の静電容量値で ΔC_{60} の算出に使用する
水和処理後の静電容量の変化率	ΔC_{60}	陰極箔の水和処理後の静電容量値 (C ₆₀) が初期の静電容量値 (C ₀) に対して変化した割合 $\Delta C_{60} = \{(C_{60} - C_0) \div C_0\} \times 100 (\%)$

注) Vt₆₀ と Tr₆₀ および C₆₀ と ΔC_{60} は60分間水和処理した場合の例を示しています。